

Title (en)

Method and installation for producing a high vacuum using a single-stage liquid-ring pump.

Title (de)

Verfahren und Einrichtung zum Erreichen eines Hochvakuums mit Gebrauch einer Einstufen-Flüssigkeitsringpumpe.

Title (fr)

Procédé et installation pour la réalisation d'un vide profond mettant en oeuvre une pompe à anneau liquide simple étage.

Publication

**EP 0058610 A1 19820825 (FR)**

Application

**EP 82400242 A 19820210**

Priority

FR 8102929 A 19810213

Abstract (en)

[origin: US4505645A] An installation for rapidly obtaining a high vacuum, comprising two compression stages, the first of which is a liquid ring vacuum pump, characterized in that means are provided for instantaneously coupling or dissociating the first stage and the second stage. The invention concerns also a process intended to be used in said installation.

Abstract (fr)

Procédé et installation permettant l'obtention rapide d'un vide profond, comprenant deux étages de compression dont le premier est une pompe à vide à anneau liquide (1), des moyens (16; 29, 20) étant prévus pour accoupler ou dissocier instantanément le premier étage (1) et le deuxième étage (14).

IPC 1-7

**F04C 23/00; F04C 29/10; F04F 5/54**

IPC 8 full level

**F04B 23/12** (2006.01); **F04C 23/00** (2006.01); **F04F 5/54** (2006.01); **F04B 41/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**F04B 23/12** (2013.01 - EP US); **F04C 23/005** (2013.01 - EP US); **F04F 5/54** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] FR 1451968 A 19660225 - NASH ENGINEERING CO
- [X] FR 1037582 A 19530921
- [X] US 3642384 A 19720215 - HUSE HENRY
- [A] US 3007322 A 19611107 - DODGE ADIEL Y
- [Y] FR 1446099 A 19660715 - STORK KONINKLIJKE MASCHF
- [Y] FR 875245 A 19420911 - RATEAU SOC

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0058610 A1 19820825; EP 0058610 B1 19880713**; AT E35721 T1 19880715; DE 3278768 D1 19880818; FR 2500086 A1 19820820;  
FR 2500086 B1 19830325; US 4505645 A 19850319

DOCDB simple family (application)

**EP 82400242 A 19820210**; AT 82400242 T 19820210; DE 3278768 T 19820210; FR 8102929 A 19810213; US 34743082 A 19820210